

株式情報

平成18年9月30日現在

発行可能株式総数	102,000株
発行済株式総数	25,707株
株主数	3,276名

■大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
富加津 好夫	4,665	18.14
株式会社エー・アンド・デイ	2,698	10.49
宮内 栄	790	3.07
新田 純	680	2.64
生江 隆男	500	1.94
富加津 英夫	500	1.94
崎山 武美	464	1.80
穴澤 紀道	435	1.69

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
売買単位	1株
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-78-2031（フリーダイヤル）
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店

会社概要

平成18年9月30日現在

会社名	株式会社ホロン（HOLON CO.,LTD.）
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル3F TEL：03-3341-6431（代）
設立	昭和60年5月
資本金	5億8,922万円
代表者	富加津 好夫
従業員数	51名
事業内容	半導体検査装置の開発、 製造、販売、保守サービス

役員

平成18年9月30日現在

代表取締役	富加津 好夫
常務取締役	穴澤 紀道
取締役	崎山 武美
取締役	新田 純
取締役	松方 清彦
取締役	安宅 正志
取締役	加藤 邦彦
常勤監査役	高柳 新次
監査役	有賀 益千代
監査役	三澤 順一

※監査役 有賀益千代及び三澤順一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

会社情報、IR情報は、ホームページでご覧いただけます。▶▶▶ <http://www.holon-ltd.co.jp>





代表取締役社長
富加津 好夫

ホロンのものさしは ナノメートル。 見えない世界を測ります。

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

半導体装置産業は、常に新しい技術革新が求められます。現在、当社の販売主力製品である65nm向けマスク寸法測定装置におきましては、技術的に成熟期をむかえ、当中間会計期間のマーケットは競合他社との競争が激化した状況で推移しました。

このような状況のもと、当中間会計期間におきましては、先行するデバイスメーカーが寸法測定装置の技術選定を終了し、発注の最終段階に来ておりますので、今後の売上に貢献できるものと考えております。

当社は、研究開発型企業として、製品性能の向上・新製品の開発に努めてまいりました。当社の強みである電子ビーム技術を軸として、新たな製品を開発し、複数製品の製造・販売による経営の安定化を図ることが当社の最重要経営課題であると認識しております。これからも、社員一人一人の能力を最大限に引き出し、それを有機的に調和・集結して製品の創造に結実させていくことで、人類の科学技術の発展に貢献し、企業価値を高めていくことに尽力していく所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

富加津社長に、ホロン創業のきっかけから今後の事業戦略まで、競争激化する市場環境を含めお話を伺いました。

● 創業のきっかけと当時の業界環境について、お聞かせください。

創業は1985年（昭和60年）ですから、もう20年ほど前のことになります。

前会社（日本電子）で、当時、新しい産業であった半導体には是非力を向けたいと思い、半導体機器本部を立ち上げました。そこでは電子ビームを使って、LSIのパターンを描く描画装置の開発に携わりました。電子ビーム描画装置は、半導体製造の基礎になる部分を担う装置です。当時、一般的に知られる業界ではなかった半導体製造装置業界でしたが、将来必ず成長する分野になるだろうという自信があり、その頃、日本電子にいた7人のメンバーで、ホロンを設立したのです。結果的に、想像以上に半導体関連装置市場は大きくなりました。



● ホロンの事業内容について教えてください。

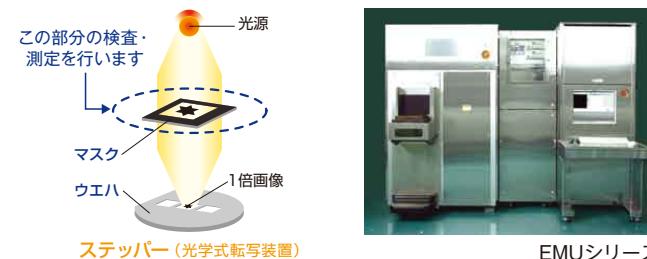
当社では、小型化及び高機能・高性能が進むPC、携帯電話、カーナビゲーションシステム、デジタル家電などの機器に不可欠な半導体が、設計どおり作られているかどうかを検査・測定する装置を開発・製造・販売しています。当初、ウエハ上に作られたパターン寸法を測る装置を年間20~30台作り世界中に出していました。

その後、メインをマスクの寸法を測る装置へと切り替えました。これが現在、世界で最も多く採用されているマスク用寸法測定装置EMUシリーズです。

当社が得意とする技術は電子ビームをコントロールする技術です。商品としては先ほど述べたマスクの寸法測定装置EMU。反射電子を使ってマスクの欠陥を調べる検査装置DIS。それから、吸収電子を利用した製品開発も行っています。

今後も当社が手がける製品は、電子ビーム技術をコアとしたものになると考えております。

市場は企業間競争が激化しておりますが、当社は何とか打破していきたいと考えております。そして、競合他社が手がけることができないような、より高い技術力を伴う新しい装置の研究開発を進めていきたいと考えています。



半導体の製造過程の中でも中核となる「フォトリソ」プロセスに使用される光学式転写装置。写真に例えると、マスクはネガフィルム、ウエハは印画紙に相当します。

製品紹介

微小寸法測定装置 EMU-270

EMU-250/260 (65nm対応) の後継機種、45nmに対応するEMU-270を開発いたしました。より厳しくなるチャージアップ対策として新たに「wind方式」を採用し、エッチング後のレジストマスクを含むすべてのマスクを安定して計測でき、測定再現性などの性能を向上させました。

CONTENTS

株主の皆様へ	1	中間財務諸表(要旨)&業績報告	5-6
社長インタビュー、TOPICS	2-4	株式情報、株主メモ、会社概要、役員	裏表紙

● 今後、どのような事業戦略をお考えですか？

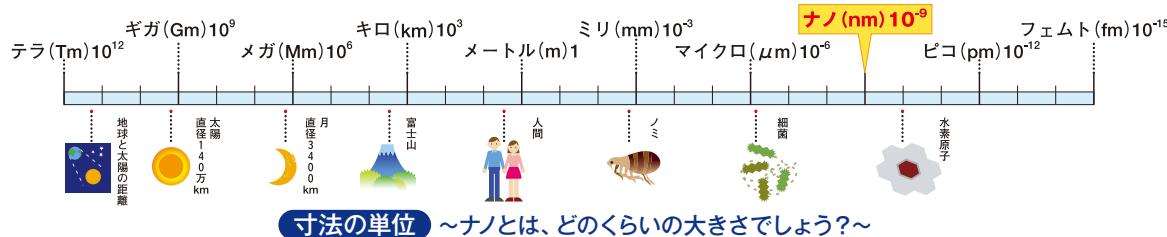
製品開発にあたり、考えなければならないのがお客様のニーズと、性能及びコストの問題です。

装置自体が大変大きなものなので、予算と実行を管理することはとても重要なことです。新しい製品を開発しても、実際に販売、普及に1年くらいの時間がかかりますので、その辺のタイムラグも考えなければならないと思っています。

今後も基本的にはマスク寸法測定装置の強化を図り、市場シェア獲得をめざしながら、市場の要求する半歩先の装置を研究・開発していきたいと思っています。測定に加えて検査もできる装置——野球で例えますと、ピッチャーの球種を増やすようなものです。この装置の開発に成功すれば、市場での圧倒的なシェア獲得につながるはずですが、その時、中心となるものは、やはり当社の電子線技術です。以前に比べて、社員の数はあまり変わりませんが、一人一人のレベルは随分アップしてきております。



今後の市場動向



● 株主様へひと言お願いします。

現在、一般的に世の中で作られている半導体は90nm対応製品が主流であり、65nm対応の製品は、最先端の技術として市場で扱われています。今後、45nm対応の製品が求められることは間違いなく、さらに、微細化の進展によりマーケットは成長していくものと思われま。65nm対応製品では他社にリードされましたが、現在、45nm対応の測定装置は、当社しかありません。昨日負けたからといって永遠に負けるといった世界ではないのです。当社の装置は、非常に稀有で特殊な仕様であり、それを支え実現する技術は、将来成長すると株主様にはご期待いただいていると思っております。これからも、新しいものに取り組んで、常に先を狙っていききたい。コアとなるテクノロジーを基盤として、事業が安定するよう企業展開を計り、売上と利益をあげ、皆様へ還元すべく努力してまいります。



HISTORY

- **1985年5月**
東京都新宿区に(株)ホロンを設立 (資本金3,300万円)
- **1986年10月**
電子ビーム微小寸法測定装置 (ESPA-11) を開発・発表
- **1996年3月**
テクニカルセンターを東京都狛江市から埼玉県所沢市に新設・移転
- **1998年12月**
マスク用電子ビーム微小寸法測定装置 EMU-200/300を開発・発表
ステンシルマスク検査技術(特許)を確立、発表
- **1999年1月**
EMU-200を海外に出荷開始
- **2003年4月**
EMU-220A、海外に出荷開始
本社ビル移転(東京都新宿区)
- **2003年7月**
第三者割当増資(資本金3億8,705万円)
- **2004年4月**
韓国支店を開設
- **2005年2月**
JASDAQ上場(2005年3月現在
資本金5億8,595万円)
- **2005年8月**
EMU-270、DIS-05を開発・発表

NEW 電子スタンパー EBLITHO

(登録商標名)

◎平成18年12月発売開始予定



LED (発光ダイオード) 生産用パターン転写装置

- 本製品は、LED (発光ダイオード) 市場をターゲットとした製造装置です。
- 本装置はステンシルマスクを利用した低加速電子ビーム高速転写装置です。当社は既に、ステンシルマスクの検査装置 (EST-300) を手がけており、当社が保有する低加速電子ビームをコントロールする技術を利用した製品です。
- この装置を利用することにより、発光面に微細な凹凸構造を正確なパターン間隔でかつ迅速に転写し、量産できることが可能になりました。LED素子表面に微細な凹凸を作ることにより、LED自ら発光させた光を素子内部に閉じ込めることなく、LED素子外部に効率よく引き出すことが可能になります。本装置を使用することにより、従来に比べ光取り出し効率は2~3倍程度の向上が期待できます。

※本仕様は、予告なく変更する場合があります。

中間貸借対照表

単位:百万円、単位未満切捨

科目	前中間期(第21期) 平成17年9月30日現在	当中間期(第22期) 平成18年9月30日現在
■資産の部		
流動資産	2,214	1,748
現金及び預金	581	624
受取手形	91	9
売掛金	510	102
たな卸資産	476	663
有価証券	444	334
その他	108	15
貸倒引当金	—	△1
固定資産	387	386
有形固定資産	262	269
無形固定資産	1	52
投資その他の資産	123	65
資産合計	2,601	2,134

新たな会計基準の導入により、貸借対照表における従来の「資本の部」の記載が「純資産の部」に変更されております。なお、前中間期「純資産の部」の数値につきましては、同「資本の部」の数値を組み替えて表示しております。

中間損益計算書

単位:百万円、単位未満切捨

科目	前中間期(第21期) 平成17年4月1日～ 平成17年9月30日	当中間期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成18年9月30日
売上高	364	105
売上原価	231	61
売上総利益	133	43
販売費及び一般管理費	280	308
営業損失	147	265
営業外収益	9	5
営業外費用	5	1
経常損失	142	260
特別利益	—	3
特別損失	—	7
税引前中間(当期)純損失	142	264
法人税等調整額	△55	0
中間(当期)純損失	86	265

科目	前中間期(第21期) 平成17年9月30日現在	当中間期(第22期) 平成18年9月30日現在
■負債の部		
流動負債	454	422
固定負債	219	260
負債合計	674	682
■純資産の部		
株主資本	1,927	1,451
資本金	585	589
資本剰余金	529	532
利益剰余金	812	330
その他有価証券評価差額金	△0	—
負債純資産合計	2,601	2,134

中間キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円、単位未満切捨

科目	前中間期(第21期) 平成17年4月1日～ 平成17年9月30日	当中間期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成18年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	△280	△220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△116	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△72	64
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	1
現金及び現金同等物の増減額	△469	△189
現金及び現金同等物の期首残高	1,395	1,149
現金及び現金同等物の中間期末残高	926	959

中間株主資本等変動計算書

(平成18年4月1日～平成18年9月30日まで)

単位:百万円、単位未満切捨

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
平成18年3月31日残高	585	529	595	1,710	1,710
中間会計期間中の変動額					
新株予約権の行使	3	3	—	6	6
中間純利益(△損失)	—	—	△265	△265	△265
中間会計期間中の変動額合計	3	3	△265	△258	△258
平成18年9月30日残高	589	532	330	1,451	1,451

新たな会計基準の導入により、貸借対照表中「純資産の部」における異動を分かり易く開示するため、新しい財務諸表として株主資本等変動計算書を掲載しております。

当中間期の概況

当中間会計期間における日本経済は、原油価格高騰があったものの、自動車等の輸出や個人消費に支えられ景気回復は堅調に推移致しました。しかしながら当社の参画しております半導体産業は、液晶等の薄型テレビ等最終商品であるデジタル家電等の大幅な販売価格ダウンにより、利益幅の点ではプラスにはなりませんでした。

半導体装置産業は、常に新しい技術革新が求められます。現在、当社の販売主力製品である65nm向けマスク寸法測定装置におきましては、技術的に成熟期をむかえ、当中間会計期間のマーケットは競合他社との競争が激化した状況で推移しました。

このような状況のもと、当中間会計期間におきましては、先行するデバイスメーカーが寸法測定装置の技術選定を終了し、発注の最終段階にきておりますので、今後の売上に貢献できるものと考えております。

上記の結果、当中間会計期間売上高105百万円(前年同期比71.1%減)、経常損失は260百万円(前年同期は142百万円の経常損失)、中間純損失は265百万円(前年同期は86百万円の中間純損失)となりました。

通期業績予想

半導体装置産業は、常に新しい技術革新を求められております。当中間会計期間は65nm向けマスク寸法測定装置導入は一服感の様相を呈し、次世代の45nm対応機導入準備期間の踊り場となっております。今暫くはこの状態が続くと考えられますが、下期から来年度にかけて本格的な需要期になると考えられます。当社は、次世代用マスクに新製品「EMU-270」を既に開発・発表、売り込みを開始しております。

又、当社独自の電子ビーム技術を活用して開発した新製品「マスク欠陥装置」DIS-05におきましては、装置評価段階の揺籃期と考えております。

こうした状況のもと当社製品は更なる装置性能の向上、機能の充実を図り、付加価値を持った製品に仕上げていく所存です。又、新しいコンセプトや性能を持った新製品の開発に努めてまいります。

通期の業績見通しにつきましては、売上高1,520百万円、経常利益76百万円、当期純利益74百万円を計画しており、平成18年5月11日付当社「平成18年3月期決算短信(非連結)」にて発表しました数値に変更ありません。